

②令和元年度産学共同研究開発支援事業の成果報告

令和元年度の産学共同研究開発支援事業で助成決定しました4社のうち本号では、森製紙有限会社(日高村)、株式会社セツロテック(徳島市)、シンワ株式会社(四国中央市)の成果を報告いたします。

【森製紙株式会社の研究開発成果】

研究開発テーマ名	デザイン性を有した多層抄き和紙の製造方法の確立
実施期間	令和元年9月～令和2年8月
企業名	森製紙有限会社
共同研究機関	高知県立紙産業技術センター
研究開発概要	包装資材やインテリア資材として活用されるデザイン紙は、デザインに応じた模様入りの抄紙網が製品ごとに必要であり、小ロットや短納期対応が困難であった。そこで無地の抄紙網上へデザイン紙用の模様を簡易に後付けで形成、また形成した模様の取り外しを可能にさせることで、小ロット、短納期対応が可能となる製造方法を開発する。その中で、従来法と同等以上のデザイン紙としてのパターンの表現・実現性についても検証する。
研究開発成果	<p>無地の抄紙網に自社独自でデザインした模様を取り付けることに成功したが、抄紙網に取り付けた模様の取り外しについては90%ほどの除去は可能であったが、100%除去には至らなかった。無地の抄紙網に自社でデザインした模様を付けて、デザイン紙の試作をしたところ、現行のデザイン入りの専用抄紙網で製造したものと比較しても、同様の模様パターンの再現性があるデザイン紙の製造に成功した。今後は模様の取り外しに関して、取り付けた模様の100%除去を可能にし、一つの抄紙網で多種のデザイン紙を製造可能にするために、研究を続けていく。</p> <p>本研究で試作した模様紙の一例</p> <ul style="list-style-type: none">・5mm角の市松模様紙をマスクの表層材として利用したもの 